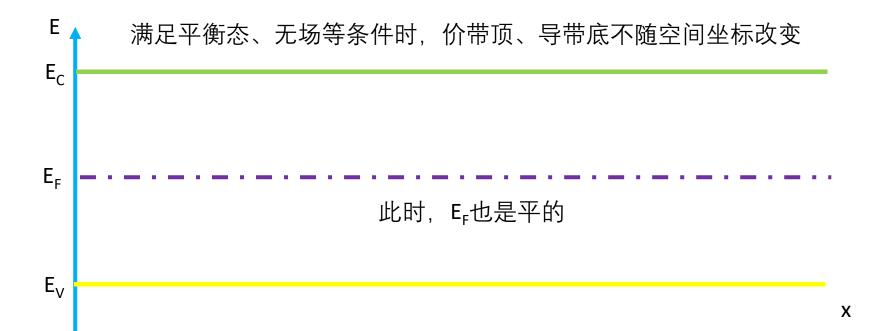
#### 课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构-基础知识
- 第二部分: 能带结构-基础知识
- 第三部分: 热力学统计-平衡态载流子浓度
- 第四部分: 载流子输运-平衡态弱场输运
  - 非平衡态初步: 强场输运
- 第五部分: 非平衡载流子

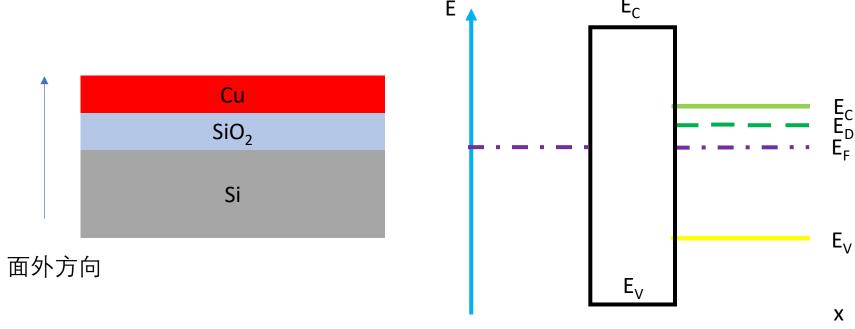
# 小结: 能帶图 (band diagram)

- 显示能带随实空间的变化, 在输运中很有用
- 能带随倒空间(k)的变化是能带结构,两者完全不同



#### 例题: 能带图

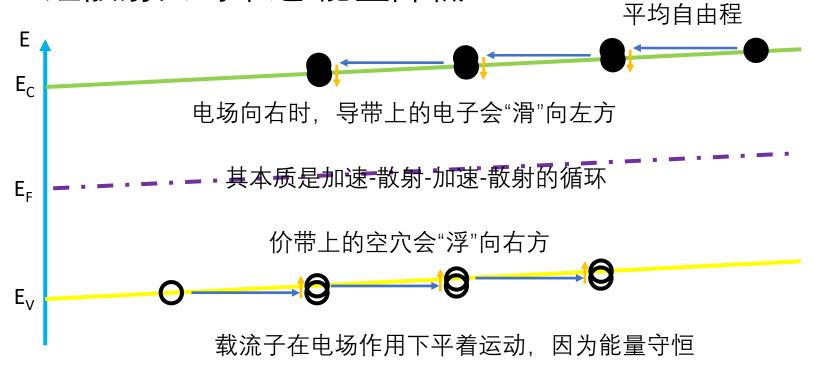
• 场效应晶体管里会用到金属-氧化物-半导体 (MOS)结构(如图)。以面外方向为横轴,试 画出能带图。假设Si为n型,E<sub>F</sub>全部一致。



注意: 仅为示意, 有因素尚未考虑, 需先学习第五章

#### 小结: 电场下的能带图

- 外加电场E后,电子加速,相对于带边能量提高
  - 空穴能量相对于带边也提高, 但表现为"降低"
- 经散射回到带边-能量降低



#### 小结: 电场作用下的输运

- 弱场输运 < 1e3-1e4 V/cm
  - 欧姆定律、常数迁移率
- 强场输运 1e3-1e4 V/cm 约1e6 V/cm
  - (漂移)速度饱和、负微分电导
  - 原因: 电场给载流子供能, 进入非平衡态("热载流子")
- 极强场击穿 >约1e6 V/cm

#### 强场下欧姆定律的失效

当E很强时,欧姆定律  $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$  不再适用,因为  $|\mathbf{v_d}| = \mu |\mathbf{E}|$  不再适用

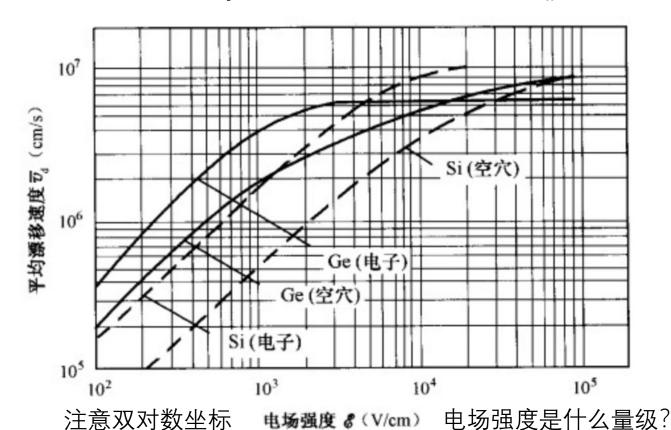


图 4-17 锗、硅的平均漂移速度与电场强度的关系 (300K)

#### 高场下的负微分电导

某些半导体在高场下会出现漂移速度随电场下降的情况

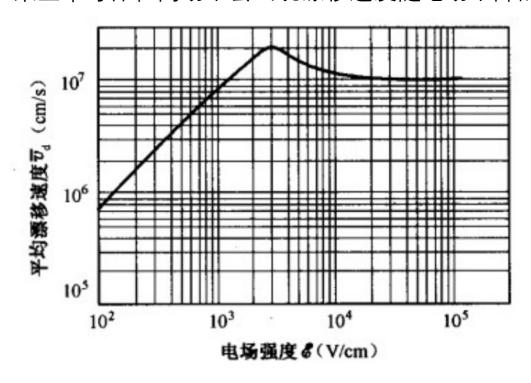
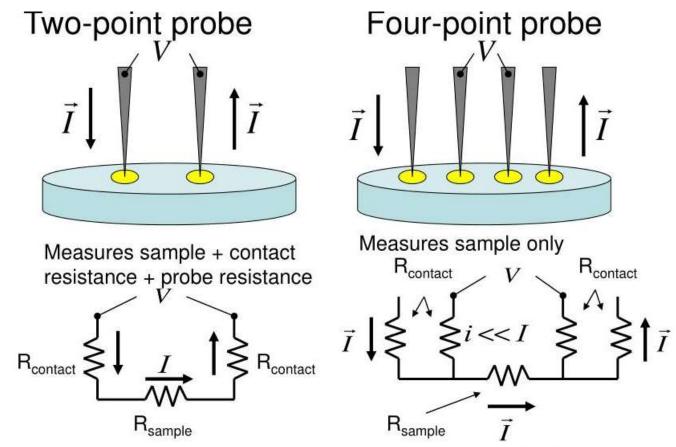


图 4-20 砷化镓电子平均漂移 速度与电场强度的关系(300K)

## 电阻率:实验测量

四端法准确测量电阻



In four-point probe, negligible current flows through the voltmeter, the only voltage drop measured is across  $R_{\text{sample}}$ .

### 迁移率: 实验测量

- 迁移率直接测量比较麻烦
- 利用 $\sigma = nq\mu$ 计算
  - 测量电阻率 (电阻测量)
  - 测量载流子浓度(霍耳效应)

霍耳棒(Hall bar)测量法:同时测量电阻率和载流子浓度

